

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-144080

(P2001-144080A)

(43) 公開日 平成13年5月25日 (2001.5.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト ⁷ (参考)
H 0 1 L 21/3085		B 0 1 J 19/00	K
B 0 1 J 19/00		C 2 3 C 14/58	Z
C 2 3 C 14/58		G 0 3 F 7/42	
G 0 3 F 7/42		C 0 1 B 13/10	D
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/302	H

審査請求 有 請求項の数7 O L (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-247924(P2000-247924)
 (62) 分割の表示 特願平4-312508の分割
 (22) 出願日 平成4年11月24日 (1992.11.24)

(71) 出願人 000005108
 株式会社日立製作所
 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
 (72) 発明者 川澄 建一
 東京都青森市藤橋888番地 株式会社日立
 製作所青森工場内
 (72) 発明者 恒川 昉芳
 東京都青森市藤橋888番地 株式会社日立
 製作所青森工場内
 (74) 代理人 100088504
 弁理士 小川 勝男 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表面処理方法及び表面処理装置

(57) 【要約】

【課題】 高レベルの金属汚染の発生を防止した表面処理装置を提供すること。

【解決手段】 オゾン発生器1、処理室8、両者の間のガスの配管4、6、7の少なくともガスと接触する部分の構成材料をアルマイト、高純度石英、フッ素樹脂、サファイア及びシリコンカーバイトからなる群から選ばれた少なくとも一種の材料とするか又はオゾン発生器1に導入される酸素及び窒素を所定の値以下の水分濃度とした表面処理装置。

